

平成 30 年 11 月 28 日

委員各位

日本学術振興会
結晶加工と評価技術第 145 委員会
委員長 柿本 浩一

(独) 日本学術振興会「結晶加工と評価技術」第 145 委員会
第 162 回研究会 開催通知 (仮)

日 時 : 2019 年 1 月 31 日 (木) 13:00~17:10

会 場 : 明治大学 駿河台キャンパス 大学会館第一、第二会議室

テ ー マ : 「半導体の微量・微小分析」

世 話 人 : 佐俣 秀一 (SUMCO)、深田 直樹 (NIMS)、上殿 明良 (筑波大)、
関口 隆史 (筑波大)

プログラム

13:00~13:05 開会の挨拶 九州大学 柿本 浩一

13:05~13:10 はじめに 筑波大学 関口 隆史

[1] 現場で要求される分析技術と最近の進歩

13:10~13:50 「シリコン半導体プロセスにおける欠陥モデリング・解析技術の現状とウエ
ハ技術に対する要望」

ソニーセミコンダクタソリューションズ (株) 小町 潤

13:50~14:30 「化学分析手法の進歩」

SUMCO 水野 泰輔

14:30~15:10 「物理分析による半導体の微量・微小部分分析」

ナノサイエンス (株) : 大淵 真澄

15:10~15:30 休憩

[2] 注目される新技術

15:30~16:00 「三次元アトムプローブ」

東北大学 大野 裕

16:00~16:30 「電子顕微鏡による半導体材料の解析・評価」

物材機構 三石和樹

16:30~17:00 「EDMR」

筑波大学 梅田 享英

17:00~17:10 おわりに

SUMCO 佐俣 秀一

17:10~17:30 委員総会

18:00~20:30 意見交換会 (明治大学 リバティータワー23階 サロン燦)

以上